

Fiche d'application n° 5

Suivi d'un procédé de dépôt de Cr(N)

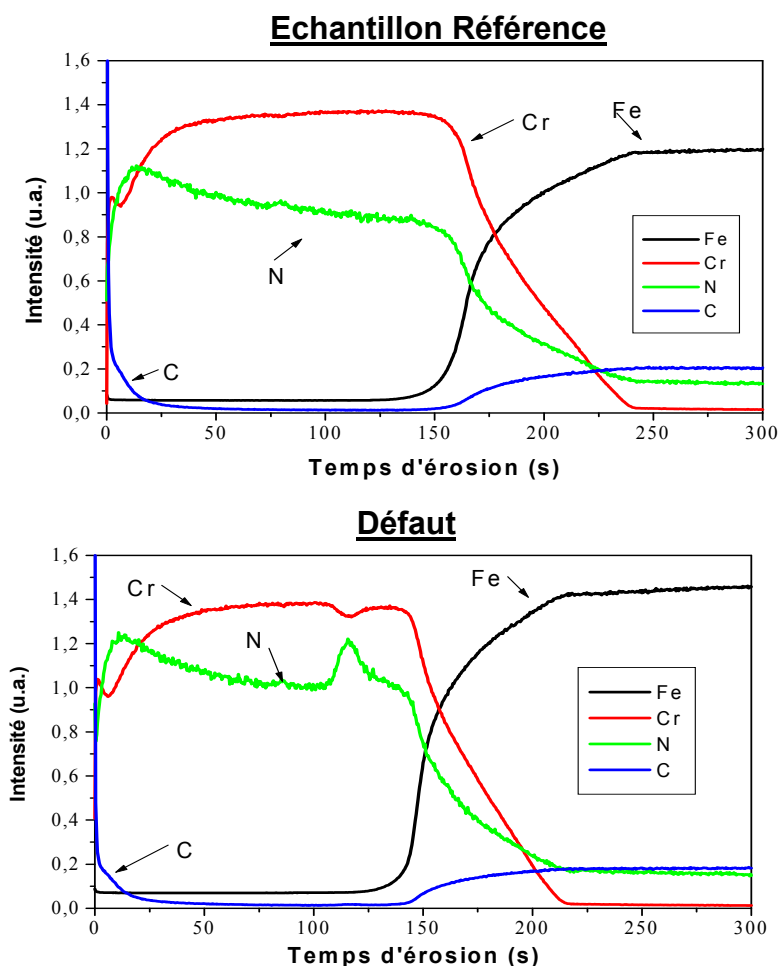
Objet : Conséquence de la dérive d'un paramètre d'un procédé de dépôt sur la structure du dépôt ?

Nécessité d'un profil qualitatif dans toute l'épaisseur du dépôt afin de comparer un échantillon de référence et un échantillon issu du procédé qui a dérivé

Technique mise en œuvre : **SDL**

- ✓ Possibilité de réaliser des profils de répartition en profondeur
- ✓ Epaisseur du dépôt est de quelques μm
- ✓ Forme et taille de l'échantillon : surface plane, de taille > 11 mm de diamètre

Résultats :



Conclusion :

Mise en évidence d'un défaut de stœchiométrie à cœur de la couche de Cr(N)